

MICROSCOPY IMAGING APPARATUS AND METHOD

Publication number: JP2000506634T

Publication date: 2000-05-30

Inventor:

Applicant:

Classification:






- international: G02B21/36; G01B11/24; G02B21/00; G06T7/00;
G02B21/36; G01B11/24; G02B21/00; G06T7/00; (IPC1-
7); G01B11/24; G02B21/36

- European: G06T7/00R3; G02B21/00; G06T7/00R7

Application number: JP19980542491T 19980403

Priority number(s): WO1998GB00988 19980403; GB19970006843
19970404; GB19970026485 19971215

Also published as:

 WO9845745 (A1)
 EP0972220 (A1)
 US6376818 (B1)
 GB2338858 (A)
 EP0972220 (A0)

more >>

[Report a data error here](#)

Abstract not available for JP2000506634T

Abstract of corresponding document: **WO9845745**

An object is illuminated by a light source (10) and a periodic pattern of transparent and non-transparent stripes is superimposed onto the object (0). At least three images are recorded at different spatial phases of the pattern by means of a microscope of shallow focal depth, and a three-dimensional image containing only in-focus detail is then derived from the recorded images by image processing which removes the periodic pattern. An illumination mask (14) or the interference fringes of two coherent beams generate the periodic pattern. The different spatial phases are generated by shifting the mask or adjusting the temporal phase difference of the coherent beams.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	P I
G 0 2 B 21/36		G 0 2 B 21/36
# G 0 1 B 11/24		G 0 1 B 11/24 K

請求項の数33 (全 11 頁)

(21) 出願番号	特願平10-542491	(73) 特許権者	999999999
(36) (22) 出願日	平成10年4月3日 (1998.4.3)		イシス イノヴェーション リミテッド
(65) 公表番号	特表2000-50634 (P2000-50634A)		イギリス国 オーエックス1 3ユービ
(43) 公表日	平成12年5月30日 (2000.5.30)	(72) 発明者	ウィルソン、 トニー
(86) 国際出願番号	P C T / G B 9 8 / 0 0 9 9 8		イギリス国 オーエックス4 1ビーエ
(87) 国際公開番号	W O 9 8 / 4 5 7 4 5		ヌ オックスフォード ジューン スト
(87) 国際公開日	平成10年10月15日 (1998.10.15)		リート 18
審査請求日	平成11年7月6日 (1999.7.6)	(74) 代理人	999999999
(31) 優先権主張番号	9 7 0 6 8 4 3, 1		弁理士 金田 暢之 (外2名)
(32) 優先日	平成9年4月4日 (1997.4.4)		
(33) 優先権主張国	イギリス (GB)	特許官	世野 秀生
(31) 優先権主張番号	9 7 2 6 4 8 5, 7		
(32) 優先日	平成9年12月15日 (1997.12.15)		
(33) 優先権主張国	イギリス (GB)		
早期審査対象出願			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 顕微鏡撮像装置および方法

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 試料の像を生成する方法であって、
前記試料を光源により照明するステップと、
前記試料の上にはほぼ周期的な空間的パターンを生成する
ステップと、
前記試料の第1の像を記録するステップと、
前記試料の上の前記パターンの空間位相を変えて前記試
料の第2の像を記録するステップと、
前記試料の上の前記パターンの前記空間位相を変えて前
記試料の第3の像を記録するステップを少なくとも1回
繰り返すステップであって、前記試料の少なくとも3つ
の記録像における前記パターンの前記空間位相が異なっ
ているステップと、
前記空間的パターンを前記像から除去し、それにより前
記試料の光学的切片像を生成するために、前記試料の前

2

記3つの以上の記録像を解析するステップと、を有し、
前記記録された像を像のベアにグルーピングし、像の各
ベア中の前記記録された像の間の差の平方の和の平方根
を計算することによって、合像像が得られ、
3つの像が記録されている場合には、式

$$I = \sqrt{(I_1 - I_2)^2 + (I_1 - I_3)^2 + (I_2 - I_3)^2}$$

(ここで前記3つの記録された像が I_1 , I_2 および I_3 であり、
前記合像像が1である)

に従って、前記空間パターンが除去される。試料の像を
生成する方法。

【請求項2】 前記試料を照明し前記試料の上にはほぼ周期的な空間的パターンを生成するために、2つのコヒーレント光源が使用される請求項1に記載の方法。

【請求項3】 前記試料の上の前記パターンを投影するマ

10

スクを使用するステップを含む請求項1に記載の方法。

【請求項4】前記マスクが1方向にのみ局所的な周期性を有する請求項3に記載の方法。

【請求項5】前記マスクがさまざまな不透明度のほぼ平行なストライプを有する請求項3または4に記載の方法。

【請求項6】前記マスクが半径方向に延びるストライプを有する請求項4に記載の方法。

【請求項7】前記マスクにおいて、ほぼ透明なストライプがほぼ非透明のストライプと交互に配置する請求項5または6に記載の方法。

【請求項8】前記ストライプの不透明度が、周期性が見出される方向にならかに変化する請求項5または6に記載の方法。

【請求項9】前記マスクがスパイラル・パターンを有する請求項3または4に記載の方法。

【請求項10】前記パターン・の前記空間位相を変える前記ステップが、前記マスクを移動させることを含む請求項3乃至9のいずれか1項に記載の方法。

【請求項11】前記パターン・の前記空間位相を変える前記ステップが、周期性が見出される方向に前記マスクを移動させることを含む請求項3乃至8のいずれか1項に記載の方法。

【請求項12】3つの記録像の前記空間位相が、それぞれ、 $\phi_1 + 120^\circ$ 、 $\phi_2 + 240^\circ$ であり、 ϕ は任意の位相である請求項1乃至11のいずれか1項に記載の方法。

【請求項13】前記パターン・の前記空間位相をほぼ連続的に変化させることを含む請求項1乃至12のいずれか1項に記載の方法。

【請求項14】前記パターン・の前記空間位相をほぼ段階的に変化させることを含む請求項1乃至12のいずれか1項に記載の方法。

【請求項15】同一試料の少なくとも3つの像の画像データ処理方法であって、前記処理はそれ上に重畳されたほぼ周期的なパターンを有し、3つの像の前記パターン・の空間位相は異なり、前記パターン・を含まない複合画像を生成するように、前記データを解析することを含み、前記記録された像を像のペアにグルーピングし、像の各ペア中の前記記録された像の間の差の平方の平方根を計算することによって、合焦像が得られ、3つの像が記録されている場合には、式

$$I = \sqrt{(I_1 - I_2)^2 + (I_1 - I_3)^2 + (I_2 - I_3)^2}$$

(ここで前記3つの記録された像が I_1 、 I_2 および I_3 であり、前記合焦像が I である)

に従って、前記空間パターンが除去される、画像データの処理方法。

【請求項16】前記パターンが1方向にのみ局所的な周期性を有する請求項15に記載の方法。

【請求項17】光源と、

ほぼ周期的な空間パターンを生成するパターン形成手段と、

前記光源からの光を試料の上に集束し、前記試料の上に前記パターンを生成する集束手段と、

前記試料の上に生成された前記パターン・の空間位相を調整する位相シフト手段と、

前記試料の像を検出するための検出器と、

前記パターン・の前記空間位相のシフトが少なくとも3つの像で異なっていて、前記試料の前記少なくとも3つの像を解析する手段と、前記試料の前記3つの像から前記空間的パターンを除去し、それにより前記試料の光学的切片像を生成する手段とを有するアナライザと、を有し、

前記記録された像を像のペアにグルーピングし、像の各ペア中の前記記録された像の間の差の平方の平方根を計算することによって、合焦像が得られ、

3つの像が記録されている場合には、式

$$I = \sqrt{(I_1 - I_2)^2 + (I_1 - I_3)^2 + (I_2 - I_3)^2}$$

(ここで前記3つの記録された像が I_1 、 I_2 および I_3 であり、前記合焦像が I である)

に従って、前記空間パターンが除去される、顕微鏡像装置。

【請求項18】前記パターン形成手段が、前記試料を照らし前記試料の上にほぼ周期的なパターンを生成する2つのコヒーレント光源を有する請求項17に記載の装置。

【請求項19】前記パターン形成手段が、マスクと、前記試料の上に前記パターンを投影する手段とを有する請求項17に記載の装置。

【請求項20】前記マスクが1方向にのみ局所的な周期性を有する請求項19に記載の装置。

【請求項21】前記マスクがさまざまな不透明度のほぼ平行なストライプを有する請求項19または20に記載の装置。

【請求項22】前記マスクが半径方向に延びるストライプを有する請求項20に記載の装置。

【請求項23】前記マスクにおいて、ほぼ透明なストライプがほぼ非透明のストライプと交互に配置している請求項21または22に記載の装置。

【請求項24】前記ストライプの不透明度が、周期性が見出される方向にならかに変化する請求項21または22に記載の装置。

【請求項25】前記ストライプが μm 幅と $30\mu\text{m}$ 幅の間である請求項21乃至24のいずれか1項に記載の装置。

【請求項26】前記マスクがスパイラル・パターンを有する請求項19または20に記載の装置。

【請求項27】前記位相シフト手段が前記マスクを動かすように適合された請求項19乃至26のいずれか1項に記載の装置。

5

【請求項28】前記位相シフト手段が、周期性が見出される方向に前記マスクを動かすように適合された請求項19乃至25のいずれか1項に記載の装置。

【請求項29】前記位相シフト手段が、前記パターンとの前記位相をほぼ連続的にシフトするように適合された請求項17乃至28のいずれか1項に記載の装置。

【請求項30】前記位相シフト手段が、前記パターンとの前記位相をほぼ段階的にシフトするように適合された請求項17乃至28のいずれか1項に記載の装置。

【請求項31】前記試料の蛍光像を検出するための検出器を有する請求項17乃至30のいずれか1項に記載の装置。

【請求項32】ほぼ周期的な空間的パターンを生成するパターン形成手段と、前記パターンとの前記空間位相を調整する位相シフト手段と、

前記パターンとの前記空間位相のシフトが少なくとも3つの像で異なっていて、前記空間的パターンがその上に生成される試料の像を解析するための手段と、前記3つの像から前記空間的パターンを除去し、それにより前記試料の光学の切片像を生成する手段を有するアナライザと、を有する。

従来の顕微鏡を請求項17乃至30のいずれか1項に記載の装置に改造するように適合された装置。

【請求項33】試料の光学的切片像を発生するために従来の顕微鏡を適合させる方法であって、前記試料の上にほぼ周期的な空間的パターンを生成するために、顕微鏡の光学系にパターン形成手段を導入するステップと、

前記試料の上に少なくとも3つの異なる空間的位相シフトパターンを作成するために、前記パターンとの空間位相を調整する空間位相シフト手段を設けるステップと、それぞれ前記パターンの異なる空間位相シフトを有する前記試料の少なくとも3つの別々の像を解析するための手段と、前記試料の前記像から前記空間的パターンを除去し、それにより前記試料の光学的切片像を生成する手段を有するアナライザを設けるステップと、を有し、前記記録された像を像のベアにグリーゼンシ、像の各ベア中の前記記録された像の間の差の平方の和の平方根を計算することによって、合焦像が得られ、3つの像が記録されている場合には、式

$$I = \sqrt{(I_1 - I_2)^2 + (I_1 - I_3)^2 + (I_2 - I_3)^2}$$

(ここで前記3つの記録された像が I_1 、 I_2 および I_3 であり、前記合焦像が I である)

に従って、前記空間パターンが除去される、試料の光学的切片像を発生するために従来の顕微鏡を適合させる方法。

【発明の詳細な説明】

本発明は、一般に合焦領域 (in-focus detail) のみ

6

を含む像を生成するための顕微鏡装置 (イメージング) 装置 (microscope imaging apparatus) および撮像方法と、そのための方法に関する。本発明は、ボリウム (体積) 構造 (volume structure) の合焦3次元像 (in-focus three dimensional image) を作るために用いることができる像を生成するのに適している。

従来の光学顕微鏡では、3次元構造を正常に撮像 (image) することはできない。得られる画像は、3次元構造の合焦領域 (in-focus region) の鮮明な像と、その合焦領域の上および下の構造の焦点のぼけた像とからなる。従来の光学顕微鏡では、焦点から外れた部分の細部 (detail) を除外することは不可能である。

完全なボリウム構造の合焦3次元像を形成するために組み合わせ可能な、構造の個々の層あるいは薄層の台帳像 (in-focus image) を提供するための、3次元構造を光学的に切断する共焦点顕微鏡が開発されている。残念ながら、非コヒーレント光源が使用されると、共焦点顕微鏡の光収支 (light budget) は、通常、不満足なものである。レーザー走査共焦点顕微鏡は、非常に浅い焦点深度を実現するが、高画質の像とレーザー光がそこを通過して焦点を結ぶ顕微鏡/結像ビームホールを必要とする。

米国特許第5,381,236号においては、3次元構造の個々の特徴部のレンジ (距離) を決定するために使用される光学センサが説明されている。このセンサは、構造を照明し可逆的である周期的なパターンを形成する光源を有する (すなわち、パターンは180°位相シフトされている)。パターンの像とその構造を照明するパターンの反転 (reversal) とを映出するために、光源のパターンに対して配列された検出器要素のアレイが使用されている。パターンは、構造のそれ自身の焦点の合っている部分に対してのみ良く撮像するのであるから、その構造の合焦部分のレンジ (距離) の決定を可能にする。米国特許第5,381,236号で説明されている装置および方法は、動作するためには、検出器の個々の素子が光源のパターンに対して正確に配列され、また適合されていなければならないという短所を有する。実際には、これは実現がほとんど不可能であることが分かっている。

本発明は、共焦点像 (confocal image) と同様な方法で実質的に合焦細部のみを有し、かつ構造の光学的セクション (切断) によりその構造の3次元像を作るために使用することができる像を作るための、顕微鏡装置および撮像方法を提供しようとするものである。本発明は、検出器およびパターン要素の正確な配列あるいは整合の必要なしに、光学的セクションを実現し、同時に有利な光収支をもたらす。

1つの局面において、本発明は、試料の像を生成する方法であって、前記試料を光源により照明するステップと、前記試料の上にほぼ周期的な空間的パターンを生成するステップと、前記試料の第1の像を記録するス

50

7

ブと、前記試料の上の前記パターンとの空間位相を変えて前記試料の第2の像を記録するステップと、前記試料の上の前記パターンと前記空間位相を変えて前記試料の第3の像を記録するステップを少なくとも1回繰り返すステップであって、前記試料の少なくとも3つの記録像における前記パターンと前記空間位相が異なっているステップと、前記空間位相のパターンを前記像から除去し、それにより前記試料の光学的切片像を生成するために、前記試料の前記3つ以上の記録像を解析するステップと、を有する試料の像を生成する方法を提供する。

上述した従来技術は、厳しい条件でマスクパターンに対して配列された整合検出器格子 (matched detector grid) に依存しているが、本発明には、このような整合検出器格子の必要がないという利点がある。像データの処理は簡単であり、本発明は、従来の顕微鏡から光学的切片像 (optically sectioned image) をリアルタイムで作成することを可能にする。

好ましい実施態様においては、試料の含焦3次元像を作成するために、上述の方法が異なる焦点位置 (focal position) で繰り返される。その結果、以下に詳細に説明する本発明の具体的な実施態様において、試料の表面組織 (surface texture) の3次元像が得られる。

パターンの空間位相は、連続的に、あるいは離散的なステップで、変えられてもよい。空間位相が連続的に変えられる場合には、試料の記録像は、所定の時間にわたって積分される。パターンの空間位相が連続的に変えられる場合には、商品像が得られることが計算され、また実際に記録されている。上に述べたように、空間位相を変化させるための広範囲の手段が、本発明の範囲内である。

さらに別の局面において、本発明は、同一試料の少なくとも3つの像の画像データの処理方法であって、前記像はそれの上に重畳されたほぼ周期的なパターンを有し、3つの像の前記パターンとの空間位相は異なり、前記パターンを含まない複合画像を生成するように、前記試料の解析を含む画像データの処理方法を提供する。

さらに別の局面において本発明は、光源と、ほぼ周期的な空間位相パターンを生成するパターン形成手段と、前記光源からの光を試料上に集束し、前記試料の上に前記パターンを生成する集束手段と、前記試料の上に生成された前記パターンと前記空間位相を調整する位相シフト手段と、前記試料の像を抽出するための検出器と、前記試料の前記空間位相のシフトが少なくとも3つの像で異なっている、前記試料の像を解析する手段と、前記試料の前記3つの像から前記空間位相パターンを除去し、それにより前記試料の光学的切片像を生成する手段とを有するアナライザと、を有する顕微鏡像装置を提供する。

パターン形成手段は、1次元の局所的な周期性を有するマスクの形態であることが望ましい、またマスクパタ

8

ーンは試料に投影されていることが望ましい、たとえば、マスクは、線形格子 (linear grating) でもよい。またマスクは、スパイラル格子 (spiral grating) を有する円形のマスクでもよい。この後者の場合に、円形のマスクの端線に向かってあるいは端線に位置する格子の一部を介して試料を照明することにより、この部分においてスパイラル格子は平行な格子に近似しているもので、パターンは好都合に試料に投影される。このスパイラル格子の利点は、マスクの回転により格子の連続した動きが実現されることである。あるいはコヒーレント光源が使用される場合には、パターン形成手段は、第1の光源からの光に干渉するように配置された第2のコヒーレント光源により提供されてもよい。

さらに別の局面において本発明は、ほぼ周期的な空間位相パターンを生成するパターン形成手段と、前記パターンと前記空間位相を調整する位相シフト手段と、前記パターンと前記空間位相のシフトが少なくとも3つの像で異なっている、前記空間位相パターンがそれの上に生成される試料の像を解析するための手段と、前記3つの像から前記空間位相パターンを除去し、それにより前記試料の光学的切片像を生成する手段を有するアナライザと、を有する従来の顕微鏡を改造するように適応された装置を提供する。

さらに他の実施態様において本発明は、試料の光学的切片像を発生するために従来の顕微鏡に適応させる方法を提供する。この方法は、前記試料の上にほぼ周期的な空間位相パターンを生成する手段と、顕微鏡の光学系にパターン形成手段を導入するステップと、前記試料の上に少なくとも3つの異なる空間位相パターンを生成するために、前記パターンと前記空間位相を調整する空間位相シフト手段を設けるステップと、それぞれ前記パターンと異なる空間位相シフトを有する前記試料の少なくとも3つの異なる像を解析するための手段と、前記試料の前記像から前記空間位相パターンを除去し、それにより前記試料の光学的切片像を生成する手段を有するアナライザを設けるステップと、を有する。

このように、実験室装置の広く普及した部分である従来の顕微鏡が、光学的切片像を生成可能なように容易に転換されることができるとは、本発明の利点である。

本発明は、さらに、同一試料の少なくとも3つの像の像データを処理する方法を提供する。像はそれの上に重畳されたほぼ周期的なパターンを有し、3つの像の上のパターンの空間位相は異なっている。前記像から、パターンを含まない合成像 (composite) を生成するように、像データのこの処理方法は、データ解析を含んでいる。

添付図面を参照して、実施例により、本発明の実施態様を説明する。

図1は、本発明による顕微鏡像装置の略図である。

図2は、本発明の光学系の略図である。

図3は、図2の系の軸方向応答の測定結果を示す。

9

図4 (a) は、本発明により得られたスリの花粉粒（視野寸法は100 μm ×70 μm である）の自動焦点像（autofocus image）である。

図4 (b) は、顕微鏡の焦点を中央の深度面（mid-depth plane）に合わせたときの、ユリ花粉粒の従来の像（本発明によりない）を示す。

図1に示す撮像装置は、従来の顕微鏡の特徴の多くを有し、特に、非コヒーレント光源10と、撮像されるべき物体10に光源10からの光を集束させる一つ以上のレンズ11の形態であることが望ましい、集束手段とを有している。ビームスプリッター12は、CCDカメラの形態であることが望ましい光検出器13に向かって物体からの反射光が反射されるように、光源と物体の間に位置している。さらに、この装置は、たとえば、格子（grating）の形態でパターンが形成され、非ゼロの空間的にほぼ周期的なパターンで物体が照明されるように光源10に備えられたマスク14を具備している。かくして、マスクパターンは試料に投影される。マスクパターンは、1次元内のみで局所的な周期性を有することが望ましい。検出器面は、物体の光学切片像が形成されることを可能にするために、投影されたパターンが集束される平面に結合している。

さらにこの装置は、マスクパターンの少なくとも3つの異なる位相が生成されるように、物体に集束されるマスクパターンの空間位相を調整するための、空間位相シフト手段15を有する。位相シフト手段15は、物体に集束されるパターンが形成された光の空間位相が変化させられるように、物体に対して段階的にあるいは連続的にマスクを移動させるためのキャリッジの形態であってもよい。縦形格子の形態のマスクの場合には、キャリッジは、撮像装置の軸線に垂直に格子を動かすために、配置される。空間位相を調整する他の選択肢には、投影されたパターンの位相をシフトするような、ビームスプリッターの移動が含まれる。

パターンは、試料上で異なる方法で生成できる。たとえば平行なストライプのパターンを描かれたリボンパルを使用することにより、パターンは確率的に生成される。ここで、光源は、試料上に、リボンのパターンを投影する。光が光源と物体の間に置かれたリボンのループの部分を通してのみ照らすように、リボンは光源の周りにそのループを形成する。あるいは、リボンは試料の周りにループを形成する。

他の選択肢は、リボンが鏡の周りにループを形成することであり、リボンの一部分が光源と鏡の間に置かれる。リボンを通過した光は、次に鏡により試料上に反射される。かくして、このようなリボンは、常に同じ方向に、連続的にあるいは段階的に動かすことができる。このようなリボンは、選択的に動かしたりあるいは動作方向に反転させたりする必要なしに、（長方形のパネルを有するマスクのように、）たとえば正確に平行なストラ

10

イプのパターンを生成する利点をもたらす。

図1において、位相シフト手段15は、撮像装置の軸線に垂直な半平面内に配置された（紙面の中心へまた外へ）3つの所定の位置にマスク14を移動させるように配置された。キャリッジの形態である。キャリッジに対する3つの位置は、マスクの3つの異なる空間位相が物体に集束されるように選択される。たとえば、3つの位相は、 ϕ 、 $\phi+120^\circ$ および $\phi+240^\circ$ であってもよい。たとえば、 ϕ 、 $\phi+90^\circ$ 、 $\phi+180^\circ$ および $\phi+270^\circ$ の、別の空間位相シフトが生成されてもよい。上記の2つの例のそれぞれにおいて、個々の空間位相の間の角度差は同じであるが、角度差が同一であることは不可欠ではない。すなわち、 ϕ 、 $\phi+90^\circ$ および $\phi+270^\circ$ の空間位相シフトが使用されてもよい。

さらに、撮像装置は、検出器に接続され、検出器の出力を解析するアナライザ16を有する。アナライザ16は、たとえば、それぞれマスクの異なる位相で照明された物体の3つ以上の像を別々に蓄積する複数のバッファの形態であるメモリ手段17を有してもよい。さらに、マスクパターンを像から除去して物体の光学的切片像を明らかにするように、アナライザ16は、3つ以上の蓄積された像を解析するためのパターン除去手段18を有する。パターン除去手段18によって生成された異なる焦点位置における複数の異なる光学的切片像を合成することにより、物体の3次元像を生成するために、標準的なレンダリング技術を使用する3次元イメージング手段19が適宜に設けられる。

パターン除去手段18は、合像（in-focus image）から錯（fringing）を差し引いたものを直接決定するために作動してもよい。たとえば、3つの像が3つの等間隔の空間位相において生成された I_1, I_2, I_3 である時、合像 I は、次式を用いることにより決定できる。

$$I = \sqrt{(I_1 - I_2)^2 + (I_1 - I_3)^2 + (I_2 - I_3)^2}$$

しかし、画像の各ピクセルに対してこの手順を実行するには、非常に多くの計算をしなければならない。あるいは、専用の画像処理装置を必要とせずにリアルタイムイメージングを可能にするためには、アナライザ16は、パターン除去手段18に接続されたルック・アップ・テーブルを具備してもよい。ルック・アップ・テーブルは、3つの入力画像値に対する上述の式のすべての解が得られる表であり、各ピクセルについての式の解の計算ではなく、テーブルの参照により、像1の決定を可能にする。

上述の撮像装置は、装置の焦点がぼかされるにつれて、物体の像の任意の非ゼロ空間周波数が減衰することを利用して、これは、物体の焦点のあった部分上のみマスクパターンが良く映し出されることを意味し、かくして、望ましくない端状（fringe）パターンが重畳されていないが、物体の焦点のあった部分をセクショニ

50

11

ングする手段を提供する。同一焦点位置であるけれどもパターン間の異なる位置された空間位相で物体の3つ以上の像を記録することにより、物体の光学的切片像を明らかにするために、重畳されたパターンを除去するために像を解析することが可能である。

マスク14は方形波パターンである線形格子の形態であることが望ましく、これは最大の光スループットを与える。交互の透明および非透明の等しい幅のバンドが適当である。より広いバンドのパターンはより深い光学的新面(optical section)をもたらす。幅5~30μm、特に12.5μmのバンドを用いて良い結果が得られるが、必要とされる光学的セクションングによっては異なる幅が適切であろう。しかし、任意に適用されたほぼ周期的な光強度パターンが使用されてもよい。好適な他のマスクには、スパイラル格子が含まれる。さらに、2次元の周期的パターンを用いてもよいが、結果として生じる像の解析は、必然的に幾分複雑となる。

パターン間隔が光学的セクションングの深さを決定するから、理想的にはマスクのパターン間隔(空間的周期性)が選択され、また照明倍率は、パターンの基本波のみが物体に投影されるように決められる。格子の3つの位相φ、φ+120°およびφ+240°が物体に投影される上述の線形方形波格子の場合には、3つの像の引き続く処理において3次元調度は自動的に相殺されるので、物体に投影される3次元調波を防止することは必須ではない。これは撮像システムの総合的な設計に大きな自由度をもたらし、装置の光収支を改善する。一般に、物体に投影されるパターンのn個の位相シフトの間の差分が各場合について同じであるときは、n次元調波およびその高調波が自動的に相殺される。

パターンの3つ以上の離散的な所定の位相シフトが物体に投影される撮像装置を以上に説明した。たとえば回転するスパイラル・マスクあるいはグリッド型マスクの連続した動きを用いて、パターンの空間位相が連続的に変化する場合には、光学的切片像を生成するために、物体の像は所定の時間にわたって積分される。

あるいは、撮像装置はコヒーレント光源を使用してもよい。これは、マスクが強度あるいは位相パターンを有することを許容する。装置の光収支が周期的強度パターン形成の場合より大きいので、周期位相パターン形成(period phase patterning)の使用が望ましい。さらに別の装置では、物体ボリューム(object volume)内に縞状パターンを生成するために、2つの光源からの光が干渉するように配置された2つのコヒーレント光ビームが使用されてもよい。2つのコヒーレント光ビームが使用される場合には、縞状パターンの所望の空間位相シフトを生ずるために、2つのビームの間の時間的位相差は変えられてもよい。1つ以上のコヒーレント光源が使用される場合には、縞状パターンは物体ボリュームを介して深く延びており、したがって検出平面な正確な輪

12

向の配列(アライメント)はもはや重要ではない。この方法は蛍光イメージングに特に適切である。

本発明の具体的な実施態様の光学系は、単に極端透過率あるいは反射率で(t₀, r₀)の物体に映し出される照明マスク、S(t₀, r₀)からなる。最終の像は、像平面(t, w)内のCCDカメラにより記録される。マスクはインコヒーレントに照明され、像強度は次の式で表される。

$$I(t, w) = \iint S(t_0, r_0) \iint h_1(t_0 + t_0, w_0 + w_0) t(t_0, r_0) h_2(t_0 + t_0, w_0 + w_0) dt_0 dr_0 \quad (1)$$

ここでh₁, h₂は2つのレンズの幅函数記号関数を表す。さらに、

$$(t, w) = 2 \frac{\pi}{\lambda} (x, y) n \sin \alpha$$

を介して座標(x, y)に関連する光学座標(t, w)を組み入れることとする。ここでn sin αは開口数(NA)であり、λは波長を表す。

ここで照明マスクは、単純化のために、次式で書くことができる1次元格子の形態をとる仮定する。

$$S(t_0, r_0) = 1 + \cos(\nabla t_0 + \phi_0) \quad (2)$$

ここでmは変調深さを、またφ₀は任意の空間位相を示す。正規化された空間周波数∇は、∇=βλv₀/NAを介して実際の空間周波数vに関連している。ここでβはグリッド平面と試料平面の間の倍率を表す。この式で(2)を式(1)に代入すれば、式(3)が得られる。

$$I(t, w) = I_0 + I_1 \cos \phi_0 + I_2 \sin \phi_0 \quad (3)$$

ここでI₀はS=1として式(1)により与えられ、当然、従来の広視野像を表す。I₁およびI₂は、それぞれ、m cos(∇t₀)およびm sin(∇t₀)の形式のマスクによる像を表す。ここで

$$I_p = \sqrt{I_0^2 + I_1^2}$$

とすれば、グリッドパターンを試料の像から除去できる。それぞれ相対的位相φ₀=0, φ₀=2π/3およびφ₀=4π/3に対応している3つの像I₁, I₂およびI₀を撮影することにより、これは実現される。このようにして、式を計算することにより、I₀を含まない光学的切片像が得られる。

$$I_p = \sqrt{(I_1 - I_2)^2 + (I_1 - I_3)^2 + (I_2 - I_3)^2}$$

これは通信システムにおける2乗測検波に類似している。

光学的切片像をリアルタイムで生成するこのシステムの能力を証明するために、従来の顕微鏡の照明経路に1m m当たり40本の1次元格子を導入した。無限大の光学的倍率を用いたので、試料上に格子の像を投影し、またCCDカメラに試料を映し出すために、別々のレンズの導入が必要であった。これは、照明平面と試料との間に(50/180)Mの実効的な倍率をもたらした。ここでMは、対物レンズの名称倍率である。15Mのダウングステン・ハロ

ゲン電球が、緑色フィルタ（帯域幅100nm）とともに光源に使用された。像はCCDカメラで記録され、Matrox Meteor社製のフレーム・グラブバー（Frame grabber）に転送された。格子は、任意の3つの連続したカメラ像が格子の投影された像の位置における1周期の3分の1の空間的シフトに対応するように、カメラのフレーム・レートに同期して単純な锯齿状に動かされた（図2）。各フレームの積分時間の間に格子が動いているという事実は、式（3）における \sin および \cos の項を $\sin c(\pi l/3T)$ のファクタだけ減少させる。ここではカメラの積分時間（integration）であり、 T は連続したフレームの記録の間の時間である。この場合 $T=2t=40$ ミリ秒であり、したがってこの係数はわずか0.955である。最悪の場合には、 $T=1$ であり、この係数はわずか0.827に低下する。光学的切片像は、8ビットカメラからの I_1, I_2 および I_3 のすべての起こり得る組み合わせを I_1 にマッピングするルック・アップ・テーブルとともに式（4）を用いて得られる。

顕微鏡の光学的切断（セクションング）強度を測定するために、校正された転移動ステージとともに平面鏡を使用した。その結果の2つのオリパス社製のMD Plan対物レンズに対する軸方向応答を図3に示す。 $50\times, 0.75NA$ の使用は、このシステムの $\nu=0.41$ に対応し、このシステムに対しては、 $0.92\mu m$ の測定値に良く匹敵する $0.87\mu m$ の半値全幅（FWHM）を予測できる。理論的には、 $150\times, 0.95NA$ の乾燥対物レンズは、 $\nu=0.8$ 、したがって $0.27\mu m$ の半値全幅を生ずると予測される。実際には、 0.95 よりむしろ 0.85 であるこのレンズの開口数に対応する $0.43\mu m$ と測定される。この相違は、大口径レンズで行われた他の測定と矛盾せず、像々の原因によるも

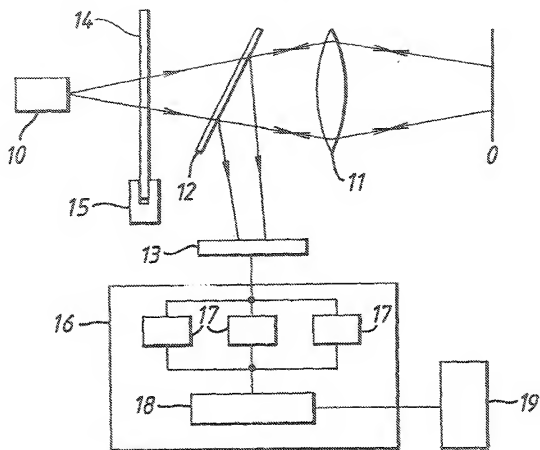
のかかもしれない。その原因の1つは、開口数の実効的なアポダイゼーションを招く周縁光源の強い減衰である可能性が高い。

ユリの花粉粒の厚いポリウム構造を映し出す像を図4に示す。図4（a）は、 $50\times, 0.75NA$ 対物レンズを用いた本発明による $30\mu m$ の軸方向走査を通じて各ピクセルにおける最高の像強度を表示することにより得られた自動焦点像を表す。粒の金表面組織は、像ポリウムの全体上で良く解像されている。他方、図4（b）は、粒を通る中間の平面において撮られた従来の像を示す。これには、かなり多量の焦点の外れたばけがあり、意味のある3次元画像処理を実行することが妨げられることが明瞭である。

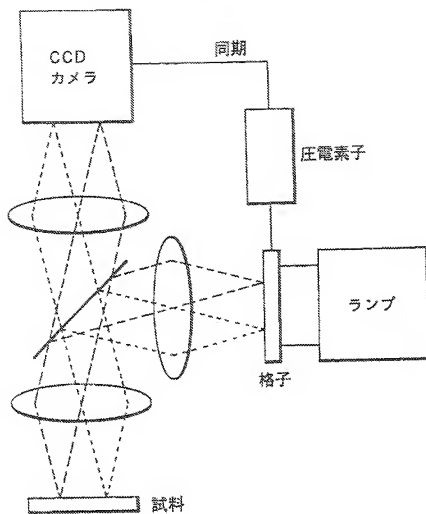
光学的切片像を生成するように、従来の顕微鏡を容易に改造できることは明白であろう。上述したように、この改造は、顕微鏡の照明系の中へのパターン形成されたマスクおよびキャリッジの導入と、アナライザの追加からなる。マスクおよびキャリッジの導入は、代わりに付加的な光学系の導入を必要とするかもしれないが、従来の顕微鏡が、物体に垂直された絞りを有する場合には、単に絞りをマスクおよびキャリッジにより置換するだけでよい。

上述の撮像装置は、たとえば暗視野および差分干渉コントラスト（differential interference contrast）を含む広範囲の撮像様式で使用することができる。さらに、この撮像装置は、従来の顕微鏡のすべての応用に使用することができる。特に、この装置は、生物医学的な応用に使用することができ、また光源としてレーザーを必要とせず、光学的に切片化された蛍光イメージングを効率的に行うことができるとする利点を有する。

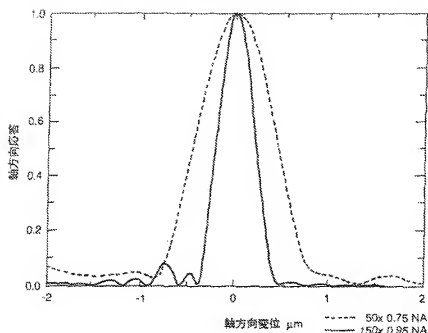
【第1図】



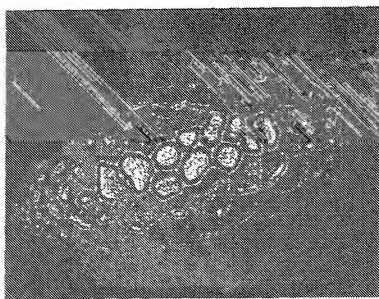
【第2図】



【第3図】



【第4(a)図】



【第4(b)図】



フロントページの続き

(72)発明者
 ネイル、 マーク、 アンドリュー、
 アクウィラ
 イギリス国 オーエックス2 9エルビ
 ー オックスフォード ボトレイ ホブ
 ラーロード 22
 ジャッカティス、 リンヴィダス
 イギリス国 オーエックス2 8エヌテ
 ィー オックスフォード マリオット
 クローズ 3

(56)参考文献 特開 平2-89015 (J P, A)
 特表 平8-509096 (J P, A)
 米国特許5381236 (U S, A)
 国際公開97/6509 (W O, A 1)

(58)調査した分野(Int. Cl.⁷, D B名)
 G02B 21/00
 G02B 21/06 21/36
 G01B 11/00 11/30

【正誤表】

【特許番号】

第2606720

第2610068

第2665508

第2666295

第2789008

第2851369

第2927568

特許第3059284号(P3059284)

特許第3068874号(P3068874)

特許第3091491号(P3091491)

特許第3114870号(P3114870)

特許第3116374号(P3116374)

特許第3117066号(P3117066)

特許第3117726号(P3117726)

特許第3120036号(P3120036)

特許第3120320号(P3120320)

特許第3126756号(P3126756)

特許第3129422号(P3129422)

特許第3129431号(P3129431)

特許第3129475号(P3129475)

特許第3130041号(P3130041)

特許第3130760号(P3130760)

特許第3133320号(P3133320)

特許第3133328号(P3133328)

特許第3133333号(P3133333)

特許第3134998号(P3134998)

特許第3136155号(P3136155)

特許第3136391号(P3136391)

特許第3138273号(P3138273)

特許第3138480号(P3138480)

特許第3141909号(P3041909)

特許第3142005号(P3142005)

特許第3142065号(P3142065)

特許第3143748号(P3143748)

特許第3144425号(P3144425)

特許第3145885号(P3145885)

特許第3146494号(P3146494)

第2750649

特許第3106188号(P3106188)

特許第3113786号(P3113786)

特許第3120988号(P3120988)

特許第3126024号(P3126024)

特許第3127741号(P3127741)

特許第3128148号(P3128148)

特許第3128150号(P3128150)

特許第3128151号(P3128151)

特許第3128152号(P3128152)

特許第3128154号(P3128154)

特許第3128155号(P3128155)

特許第3128238号(P3128238)

特許第3129889号(P3129889)

特許第3132660号(P3132660)

特許第3135821号(P3135821)

特許第3135955号(P3135955)

特許第3137846号(P3137846)

特許第3143654号(P3143654)

特許第3143655号(P3143655)

特許第3146341号(P3146341)

特許第3146425号(P3146425)

特許第3148272号(P3148272)

正 誤 表

(平成13年6月25日(2001.6.25)発行)

特 許 番 号	分 類	発 明 記 号	備 考	誤	正
2605720	C07D 233/90		特許権者住所 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目3番22号	大阪府大阪市西区江戸堀1丁目3番10号	大阪府大阪市西区江戸堀1丁目3番10号
2610658	C05D 15/16		特許権者住所 愛知県小牧市大字北外山字早崎303番地	愛知県小牧市南2丁目250番地	愛知県小牧市南2丁目250番地
2655608	B01D 53/38		特許権者名 氏 (1人目) (目次とも)	工業技術院長 平石 次郎	工業技術院長
2655295	H03H 9/17		特許権者住所 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
2739608	G11B 7/25	531	発明の名称 (目次とも)	光ディスク	光ディスクの製造方法
2851399	D21F 7/00		第3欄22行	ウエバ	ウェブ
2927658	C09B 31/058		第4欄42～43行 第8欄35～36行	式A-X-B-RE ₁ (4) 式A-X-B-RE ₁ (4)(式中、	式A-X-B-RE ₁ (4) 式A-X-B-RE ₁ (4) (式中、
3059246	B60C 9/00		優先権主張 80111951.1 平成2年6月25日 (1990.6.23) 米国(US)	80111951.1 平成2年6月25日 (1990.6.23) ベルギー(BE)	80111951.1 平成2年6月25日 (1990.6.23) ベルギー(BE)
3069874	G02B 21/38		特許請求日 平成11年7月6日(1999.7.6)	平成11年7月8日(1999.7.8)	平成11年7月8日(1999.7.8)
3091491	B41C 1/04		第12欄40～41行 複数の撮写メモリ型 第12欄49行 複数の出力メモリ型	スキューメモリ30 複数の撮写メモリ型 複数の出力メモリ38	第1のメモリ、即ちスキューメモリ30 第2のメモリ、即ち複数の撮写メモリ32 第3のメモリ、即ち複数の出力メモリ38
3114870	G06F 9/445		発明の名称 (目次とも)	マイクロプログラムローディング方法とローディング制御装置と情報処理装置と情報処理システム	情報処理システム及びマイクロプログラムローディング方法
3119374	H04N 5/225		発明の名称 (目次とも)	プリンタ内蔵カメラ	カメラ
3117066	E02D 17/20	102	発明の名称 (目次とも)	法面の補強・緑化工法およびその装置シート	法面の補強・緑化工法

特 許 番 号	分 類	発 明 の 種 別	発 明 の 名 称	正
3117725	A61K 31/635		優先権主張 (1 番目) (2 番目) 60/013,893 平成8年3月22日 (1996.3.22) ヨーロッパ特許庁(E P) 9606372.2 平成8年3月26日 (1996.3.26) ヨーロッパ特許庁(E P)	60/013,893 平成8年3月22日 (1996.3.22) 米国(US) 9606372.2 平成8年3月26日 (1996.3.26) イギリス(GB)
3120036	F16F 15/30		分割の表示	図面
3120320	C08J 5/24		分割の表示	図面
3126756	H01J 17/20		発明の名称 (目次とも)	直流型放電パネルと表示装置
3129422	H01L 27/116		発明の名称 (目次とも)	直流型放電パネルをパルスメモ リ駆動する表示装置
3129431	C07F 13/00		低先権主張 272,177 昭和63年11月16日 (1988.11.16) 米国(US)	282,177 昭和63年11月16日 (1988.11.16) 米国(US)
3129475	H01H 15/02		代理人	代理人 弁理士 熊野 敬史
3130041	B65D 5/68	301	発明の名称 (目次とも)	ふたをスナップ止めする装置
3130760	F01N 1/10		発明の名称 (目次とも)	消音器及びその製造方法
3133320	B06B 7/04		第1欄1行	ガス流路
3133328	C12Q 1/06		特許権者住 所 (2 人目)	静岡県浜松市砂山町325-6 静岡県浜松市野町1120番地 の1
3133333	B32B 5/08		第9欄1行	加速時計
3134938	B29C 47/16		発明者氏名	平川 洋一
3135155	C22B 1/10		発明の名称 (目次とも)	金属酸化物鉱石の予熱及び予 備還元

特 許 番 号	分 類	識別 記号	箇所	部	正
3136351	H06K 1/03	630	発明者 (1人目)	絶電	三井 隆二 神奈川県川崎市中原区新谷 335番地 三井造船工業株式 会社内
3138273	G09F 9/00	352	発明の名称 (目次とも)	表示パネル用プローブ	表示パネル用プローブ
3139490	H04N 5/91		発明の名称 (目次とも)	縦横装飾を備えたデジタル倍 写記録再生装置	縦横装飾を備えたデジタル 倍写記録再生装置
3141909	H01L 25/786		代理人	脱落	代理人 弁護士 藤田 昭之
3142005	H01L 29/68		発明者氏名	川本 昂	川本 昂
3142065	G01N 30/48		代理人	代理人 弁護士 大島 正孝	削除
3145748	B65B 7/20		特許権者住 所	東京都千代田区九段南2丁目 2番4号	東京都文京区奥口二丁目3番 3号
3144425	F02N 11/10		特許権者住 所 (1人目)	東京都江東区豊砂3-9-1 -232	東京都豊島区剛町が谷2丁目 3番13号 MKS目白ハイッ 302号
3145885	H01S 3/08		発明の名称 (目次とも)	多形遷移品のエネルギー抽出係 数を増大する方法	多形遷移品のエネルギー抽出係 数を増大させる方法
3146494	H04Q 7/16		発明の名称 (目次とも)	無線通信システムにおいて送 信機を識別する方法および装 置	無線通信システムにおいて送 信機を識別する装置

特許権者の名義変更

(平成13年8月25日(2001.8.25)発行)

特 許 登 号	分 類	図 別 記 号	出 願 番 号	旧特許権者	新特許権者
2750649	B32B 5/18		甲 4-337796	株式会社高瀬染工場 大阪府大阪市都島区都島本通 1丁目7番19号	大和紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町 3丁目6番8号
3106168	B30H 1/00	101	平 3-348096	株式会社ボッシュオートモー ティブシステム 東京都渋谷区渋谷3丁目6番 7号 代理人 弁理士 渡部 敏彦	株式会社ゼクセルヴァレोक ライメートコントロール 埼玉県大里郡江南町大字千代 字東原38番地
3113785	H05H 1/46		甲 6-330240	東京エレクトロン株式会社 東京都港区赤坂5丁目3番6 号 上記1名の代理人 弁理士 能谷 英明 (外1名) 東京エレクトロン山梨株式会 社 山梨県茅渚市藤井町北ノ条 2381番地の1	東京エレクトロン株式会社 東京都港区赤坂5丁目3番6 号 代理人 弁理士 能谷 英明 (外1名)
3120988	B26F 1/20		平 2-24587	ペリニ・ナヴィ・ソシエタ・ ベル・アチオーニ イタリア国、ルツカ、ヴィア ・ル・カルドウイッチ・ニユ スロ、427 代理人 弁理士 八木田 茂 (外2名)	フアビオ・ペリニ・ソシエタ ・ベル・アチオーニ イタリア国、66100・ルツカ、 ヴィア・ベル・ムグナノ(番地 なし) 代理人 弁理士 八木田 茂 (外2名)
3126024	F24H 1/00	606	平 1-38564	川崎製鉄株式会社 兵庫県神戸市中央区北本町通 1丁目1番28号 代理人 弁理士 松尾 昭一 郎	同前
上記は特許出願人の名義が税定登録簿に登録されたものである。					

特許 番 号	分 類	識別 記号	出願番号	旧特許権者	新特許権者
3127741	E04J 3/16		平 6-230358	ケイディディ株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目3番2号 代理人 弁理士 山本 恵一	株式会社ディーディーアイ 東京都千代田区一ツ樹町6番地 代理人 弁理士 山本 恵一
3128148	C08G 59/42		平 3-233832	東燃株式会社 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー 代理人 弁理士 河衛 健二	東燃ゼネラル石油株式会社 東京都港区海岸一丁目16番1号 代理人 弁理士 河衛 健二
3128150	C08G 59/42		平 3-250331	東燃株式会社 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー 代理人 弁理士 河衛 健二	東燃ゼネラル石油株式会社 東京都港区海岸一丁目16番1号 代理人 弁理士 河衛 健二
3128151	C08G 59/42		平 3-250332	東燃株式会社 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー 代理人 弁理士 河衛 健二	東燃ゼネラル石油株式会社 東京都港区海岸一丁目16番1号 代理人 弁理士 河衛 健二
3128152	C08G 59/42		平 3-250333	東燃株式会社 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー 代理人 弁理士 河衛 健二	東燃ゼネラル石油株式会社 東京都港区海岸一丁目16番1号 代理人 弁理士 河衛 健二
3128154	C08G 59/42		平 3-250002	東燃株式会社 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー 代理人 弁理士 河衛 健二	東燃ゼネラル石油株式会社 東京都港区海岸一丁目16番1号 代理人 弁理士 河衛 健二
上記は特許出願人の各々が設定の登録前に承継されたものである。					

特許 番号	分類	識別 記号	出願番号	旧特許権者	新特許権者
3128155	C08C 69/42		平 3-256003	東燃株式会社 東京都渋谷区広尾一丁目1番 39号 恵比寿プライムスクエ アタワー 代理人 弁護士 河端 健二	東燃ゼネラル石油株式会社 東京都港区港南一丁目16番1 号 代理人 弁護士 河端 健二
3128238	C12N 7/00		平 3-510648	フェルミン、セザール、ディ ー、 アメリカ合衆国 70448 ルイ ジアナ州 マンデビル、クッ ドローン レーン 103 アレクサンダー、ジュニア スティーブ エス、 アメリカ合衆国 20877 メリ ーランド州 ギヤースバー グ、ロックロッジ ロード 505 代理人 弁護士 平木 祐輔 (外2名)	明峰
3128689	G05B 19/4165		平 6-218341	日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 株式会社牧野フリス製作所 東京都目黒区中根2丁目3番 19号 代理人 弁護士 金田 健之 (外2名)	株式会社牧野フリス製作所 東京都目黒区中根2丁目3番 19号 代理人 弁護士 金田 健之 (外2名)
3132680	G08F 4/554		平 3-247586	東燃株式会社 東京都渋谷区広尾一丁目1番 39号 恵比寿プライムスクエ アタワー 代理人 弁護士 河端 健二	東燃ゼネラル石油株式会社 東京都港区港南一丁目16番1 号 代理人 弁護士 河端 健二
上記は特許出願人の名義が限定の登録前に承継されたものである。					

特 許 番 号	分 系	発 明 記 号	出 願 番 号	旧特許権者	新特許権者
3135821	H05B	7/14	平 7-178385	東京製薬株式会社 東京都千代田区内幸町2丁目 2番2号 富田生命ビル 代理人 井理士 菊地 耕一	熊鷹
3135955	G02C	7/04	平 3 281488	ビルキントン ビジョンケア ー インコーポレーテッド PILKINGTON VISION CARE INCORPORATED アメリカ合衆国 カリフォル ニア州 94086-5200 サニ ーグエイル キファアー ロー ド 810 代理人 井理士 杉村 曉秀 (外5名)	ビービーエイチ インコーポ レイテッド アメリカ合衆国 カリフォル ニア州 94086-5200 サニ ーグエイル キファアー ロー ド 810 代理人 井理士 杉村 曉秀 (外6名)
3137846	H04N	7/20	610 平 6-287153	レイセオン・カンパニー Raytheon Company アメリカ合衆国 マサチュー セッツ州02421、レキシント ン、スプリング・ストリート 141 代理人 井理士 鈴江 武彦	ヒューズ・エレクトロニクス ・コーポレーション HOUGHES ELECTRONICS CORPORATION アメリカ合衆国、カリフォル ニア州 90245、エル・セグ ンド、ノース・セブルベーク ・ブールバード 800 代理人 井理士 鈴江 武彦 (外4名)
3143654	F02K	7/18	平 5- 88779	防衛庁技術研究本部長 東京都新宿区市谷本村町5番 1号 防衛庁技術研究株式会社 神奈川県横浜市中区富町 2番地 代理人 井理士 小堀 豊	防衛庁技術研究本部長 東京都新宿区市谷本村町5番 1号 上記1名の代理人 井理士 小堀 豊 株式会社アイ・エイチ・アイ ・エアロスペース 東京都千代田区大手町二丁目 2番1号

上記は特許出願人の名義が設定の登録前に承継されたものである。

特 許 番 号	分 類	識別 記号	出願番号	旧特許権者	新特許権者
3143555	F02K 7/10		平 5-162531	防衛庁技術研究本部長 東京都新宿区市谷本村町5番 1号 百歳自動車株式会社 神奈川県横浜市神奈川区宝町 2番地 代理人 弁護士 小堀 豊	防衛庁技術研究本部長 東京都新宿区市谷本村町5番 1号 上記1名の代理人 弁護士 小堀 豊 株式会社アイ・エイチ・アイ ・エアロスペース 東京都千代田区大手町二丁目 2番1号
3146341	C22C 5/04		平 7-295136	科学技術庁金属材料技術研究 所長 茨城県つくば市千環一丁目2 番1号	文部科学省金属材料技術研究 所長 茨城県つくば市千環一丁目2 番1号
3146405	E04F 11/02		平 4-12165	株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目 8番15号 代理人 弁護士 松本 敏明	削除
3148272	G02B 5/17		平 3-90026	エステイシー・リミテッド STC LIMITED イギリス国、パークス エス エル8・1エーワイ・メイデ ンヘッド・スタッフアートン ・ウェイ(登録なし) 代理人 弁護士 錦江 武彦	ノーテル・ネットワークス・ リミテッド カナダ国 エッチ・2・ワイ 3・ワイ・4 ケベック州 モントリオール セイント アントワーヌ ストリート ウエスト 380 ワールド トレード センター オブ モントリオール エイスフ ロアー 代理人 弁護士 錦江 武彦 (外4名)
上記は特許出願人の名義が認定の登録前に承継されたものである。					